

カスタムPtfеウェーハキャリア洗浄バスケット 耐食性 非浸出

高分子実験用サポート

商品番号: PL-CP264



前書き

半導体および高分子研究向けに設計された高性能カスタムPTFEウェーハキャリアと洗浄バスケット。優れた耐食性とゼロ浸出特性を備えたこの特注ソリューションは、要求の厳しい化学環境下での無汚染処理を実現し、高精度な実験・産業用途に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主なメリット
半導体ウェットエッチング	酸ベースのエッチングプロセスでシリコンウェーハを固定し、酸化物除去やパターン画定を行う	化学的不活性さにより浴の汚染を防止
微量金属分析	環境・地質研究のため、高純度酸浴で実験器具やサンプルを洗浄する	金属浸出がゼロで分析精度を確保
高分子合成	高温溶媒系反応において触媒担体や基板を支持する	高い耐熱性と非粘着表面を実現
太陽電池製造	大判シリコン基板を多段階洗浄・テクスチャリング浴で搬送する	堅牢な構造で高スループットに対応
医薬品分野での洗浄	強力な洗浄液中で繊細なガラス・金属部品を滅菌・洗浄する	高純度・非汚染基準への準拠を実現
電析	腐食性電解液中での金属めっき・成膜時に基板を固定する	電気絶縁性と化学的安定性を提供
オプトエレクトロニクス処理	LED・レーザーダイオード製造のため、ガラス・サファイア基板の洗浄・ハンドリングを行う	傷のないハンドリングと残渣のないすずぎを実現
高温乾燥	湿式槽からウェーハを直接加熱乾燥チャンバーまたはオープンに移動する	260°Cまで構造的完全性を維持

特長	仕様詳細 (PL-CP264シリーズ)
製品識別	PL-CP264 カスタムウェーハキャリア
主要材料	高純度バージンPTFE (オプションでPFAも選択可能)
カスタマイズ状況	100%特注/受注生産
温度範囲	-200°C~+260°C (-328°F~+500°F)
化学適合性	全般的適合 (溶融アルカリ金属を除くすべての酸、塩基、溶剤に対応)
スロット構成	カスタマイズ可能 (幅、ピッチ、角度、深さ)
ウェーハ適合性	1インチ、2インチ、4インチ、6インチ、8インチ、12インチまたは非標準形状に対応したカスタムサイズ
製造方法	高精度CNC加工
表面仕上げ	滑らか、低摩擦、非多孔質
ハンドルオプション	一体型、着脱式、またはロボットインターフェース
バッチ容量	ユーザー仕様に基づいた設計 (単一ウェーハまたは複数ウェーハに対応)